表面改性多孔二氧化硅减反膜的稳定性研究

熊怀^{1,2}*, 唐永兴^{1,2}, 胡丽丽^{2,3}, 沈斌¹, 李海元¹

1中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理重点实验室,上海 201800;

³中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术研发中心,上海 201800

摘要 以正硅酸乙酯为原料,采用溶胶-凝胶法制备 SiO₂溶胶,通过提拉法涂制多孔 SiO₂减反膜,并在多孔 SiO₂减 反膜上涂制一层甲基三乙氧基硅烷(MTES)预聚体。通过疏水的 MTES 预聚体涂制在多孔 SiO₂减反膜上,对多孔 SiO₂减反膜的表面进行改性,以提高膜层的环境稳定性。经过表面改性的复合膜层的透过率峰值可达 99.67%,折 射率为 1.231,水接触角达 123.6°,在相对湿度为 95%的环境中放置 475 d 后膜层的峰值透过率为 99.09%,稳定性 提高明显。膜层表面平整,激光损伤阈值约为 24.5 J/cm²。

关键词 材料;薄膜;减反膜;溶胶-凝胶法;稳定性

中图分类号 O484.4 文献标识码 A

doi: 10.3788/AOS201939.0831001

Stability of Surface-Modified Porous Silica Antireflective Coating

Xiong Huai^{1,2*}, Tang Yongxing^{1,2}, Hu Lili^{2,3}, Shen Bin¹, Li Haiyuan¹

 ${}^{\scriptscriptstyle 1} \textit{Key Laboratory of High Power Laser and Physics} \,, \,\, \textit{Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics} \,,$

Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China;

² Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

³ Research and Development Center of High Power Laser Components, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China

Abstract SiO₂ sol is prepared using the sol-gel process with tetraethyl orthosilicate as the precursor, and the porous SiO₂ antireflective coating is fabricated using the dip coating method. Further, the surface of the SiO₂ coating is covered using a methyltriethoxysilane (MTES) prepolymer. The objective of the experiment is to use the hydrophobic MTES prepolymer film as a cover of the surface of the SiO₂ coating and to modify the surface of the coating. Ultimately, we intend to improve the environmental stability of the porous SiO₂ coating. Thus, an surface-modified composite coating exhibiting a peak transmission of 99.67%, refractive index of 1.231, and water contact angle of 123.6° is obtained. Furthermore, the peak transmission of the coating becomes as high as 99.09% and its stability considerably improves after being maintained at a relative humidity of approximately 95% for 475 days. It can also be observed that the modified coating surface is smooth and that the laser-induced damaged threshold is 24.5 J/cm^2 .

Key words material; thin film; antireflection coating; sol-gel method; stability OCIS codes 160.4670; 310.1210; 160.6060; 310.6860

1 引 言

自 20 世纪 80 年代 Thomas^[1]用 SiO₂ 悬胶体制 备出具有高激光损伤阈值的多孔减反膜以来,采用 溶胶-凝胶法制备的光学薄膜就被广泛地应用于高 功率激光装置中,如美国利弗莫尔国家实验室 (LLNL)的激光装置中有数千片大口径光学元件就 是采用溶胶-凝胶法来涂制膜层的,包括隔板玻璃减 反膜、磷酸二氢钾(KDP)晶体防潮/减反膜、三倍频 石英靶镜/防溅射板等^[1-3]。

高功率激光装置中采用溶胶-凝胶法制备的 SiO。减反膜,其膜层的孔隙率较高,膜层中大量亲

²中国科学院大学材料与光电研究中心,北京 100049;

收稿日期: 2019-03-11;修回日期: 2019-04-01;录用日期: 2019-04-15

^{*} E-mail: xhuai1998@siom.ac.cn

水的 Si-OH 基团容易吸收环境中的水汽而导致膜 层的使用寿命下降。国内外研究人员针对膜层的耐 环境稳定性展开了研究。例如:文献[4-6]采用氨水 和六甲基二硅胺(HMDS)化学气氛处理方法,使膜 层中亲水的 Si-OH 基团生成 Si-O-Si(CH₃)₃非 极性疏水基团,膜层的透过率稳定性大幅提高,使用 寿命得以延长;文献[7]以正硅酸乙酯(TEOS)和甲 基三乙氧基硅烷(MTES)为前驱物制备了甲基化硅 溶胶,膜层的疏水基团几乎不受潮气的影响;文 献[8-10]在溶胶阶段进行化学改性,将 HMDS 引入 到 SiO₂ 溶胶中,使得膜层的疏水防潮性能大大提 升,水接触角可达140°以上。采用有机基团对膜层 进行改性已被众多研究人员认可,但是大多数研究 关注的是化学气氛后处理以及胶体阶段的有机改 性。在高功率激光器中,石英靶镜、防溅射板等三倍 频元件受高通量激光辐照后,其减反膜的透过率稳 定性影响着激光器的整体性能。例如,用来保护终 端光学元件免于靶丸溅射伤害的次防溅射板,其采 用的是经化学气氛后处理的 SiO2减反膜,该膜呈疏 松多孔、开放的表面结构,激光打靶后,靶丸溅射物 进入膜层内部,并在吸收后续发次激光能量后可能 气化膨胀,导致膜层结构被破坏,降低透过率。故通 常情况下,激光器运行4发次就需要更换次防溅射 板。目前,次防溅射板是更换最频繁的三倍频元件, 也是影响装置运行效率和成本的重要因素。本文采 用 MTES 预聚体薄层涂制在多孔 SiO2 减反膜表面 的方法来制备表面改性减反膜,对膜层进行热处理 后, MTES 预聚体与膜层表面的 SiO₂ 颗粒形成化 学键合,在SiO。颗粒层表面形成一层具有致密结 构的薄层,填充颗粒层中颗粒与颗粒之间的孔隙 以及颗粒表面的孔隙,这个薄层可以起到保护层 的作用,隔绝颗粒层与空气的大部分接触。将该 改性减反膜应用于三倍频光学元件,尤其是需要 频繁更换的次防溅射板,将会大幅提高元件的使 用寿命,有助于大型激光器运行效率的提高以及 成本的降低。

2 实 验

2.1 涂膜液的制备

SiO₂ 悬胶体的制备:将 TEOS、去离子水、氨水 (NH₃•H₂O)、无水乙醇(C₂H₅OH)、聚乙二醇 (PEG200)按物质的量比为1:2:0.9:34.2:0.08 混 合,混合液在5℃左右搅拌5h,然后升温至20℃搅 拌2h,之后将溶液密封,并在50℃下陈化一定时间 后回流除氨,再用乙醇按体积比为1:1稀释即可获 得 SiO₂ 悬胶体。

MTES 预聚体的制备:采用分步法制备,将 MTES、去离子水和 C_2 H₅ OH 按物质的量比为 1:5:1混合,先将 MTES 与部分 C_2 H₅ OH 搅拌均匀 并加热至 80 °C,再分步加入 C_2 H₅ OH 与去离子水 的混合液,然后依次进行水解、聚合、蒸馏,得到无色 透明的质量分数约为 38%的 MTES 预聚体;取 5 mL MTES 预聚体用 400 mL 无水乙醇稀释后得 到 poly-MTES 涂膜液。

2.2 膜层的制备

减反(AR)膜的制备:用自制的提拉涂膜机,以 6~8 cm/min的提拉速度在清洗干净的Φ32 mm× 7 mm 的石英玻璃上涂制 SiO₂ 减反膜,然后在 200 ℃下热处理 10 min(改变拉膜速度可调节膜层 的厚度,控制膜层的峰值透过率波长在351 nm附 近)即可得到 AR 膜。

 $AR+NH_3/HMDS 膜的制备:将涂有 AR 膜的石$ 英基片放入盛有 30 mL NH₃•H₂O 和 30 mL HMDS的密闭容器中进行化学气氛处理,将容器升温至150 ℃,在此温度下热处理 48 h 即可得到 AR+NH₃/HMDS 膜。

AR-M 膜的制备:将涂有 AR 膜的石英基片浸入 poly-MTES 涂膜液中,分别以 5,6.5,10,15,20 cm/min的提拉速度制备得到 SiO₂ 复合减反膜,并在 200 ℃下热处理 30 min 左右,得到 AR-M5、AR-M6.5、AR-M10、AR-M15 和 AR-M20 膜。

2.3 性能测试

采用美国 Perkin Elmer 公司生产的 Lambda900 紫外可见光分光光度计测试膜层的透 过率(150 mm 积分球);采用德国 DataPhysics 公司 的 OCA 40 测试膜层的接触角;采用美国 Digital Instruments 公司的 Dimension[™] 3100 原子力显微 镜(AFM)测试膜层的表面形貌;采用法国 SOPRALAB 公司型号为 GES-5E 的椭圆偏振光谱 仪测试膜层的折射率;采用美国 ZYGO 公司的 Nomad[™] 3D 表面轮廓仪测量膜层的表面粗糙度。

3 分析与讨论

3.1 膜层改性后的光学性能

MTES 预聚体(CH₃SiO_{1.5})是无色透明液体,分子结构呈链状,应用于激光器的磷酸二氢钾(KDP) 晶体防潮膜(一种含有 Si-CH₃疏水基团的致密膜 层)已有 20 多年的历史^[11]。AR、AR-M5、AR-M6.5

和 AR-M10 膜的折射率分别为 1.181、1.222、1.231 和 1.245 (350 nm 处), 如图 1 所示。随着 poly-MTES 涂膜液中提拉速度的增加,复合膜层中 MTES 预聚体的含量增加, 孔隙率逐渐减小, 折射 率逐渐增大。由图 2 可知: AR-M5 和 AR-M6.5 复 合膜层的透过率峰值分别为 99.76%和 99.67%,与 未表面改性的 AR 膜透过率峰值(99.64%)相当;但 是当提拉速度提高至 10 cm/min 及以上时, AR-M 复合膜层的透过率明显降低。可见,表面覆盖 MTES 预聚体超过一定量后会影响膜层的减反性 能。对多孔 SiO₂减反膜进行表面改性,原则上不能 降低膜层的减反性能,在维持高透过率的情况下,表 面覆盖层应尽可能厚一些,以提高表面致密层的有 效覆盖率,故将AR-M6.5作为主要研究对象。图 3 是 AR-M6.5 膜表面改性前后的透过光谱,可见,改 性后的透过光谱没有明显变化,保留了 AR 膜良好 的光学减反射性能,水接触角可达123.6°, 疏水性较 好。图 4 是 AR+NH3/HMDS 膜的透过光谱,可 见,AR 膜经化学气氛处理后,折射率增至1.194。



Fig. 1 Refractive indices of AR coatings before and after surface modification







图 3 AR-M6.5 复合膜层表面改性前后的透过光谱, 图中插图给出了对应的接触角测试结果

Fig. 3 Transmittance spectra of AR-M6.5 composite coating before and after surface modification, and corresponding water contact angle test result of AR-M6.5 coating is given in inset



3.2 膜层的表面形貌

图 5 为 AR 膜表面改性前后的 AFM 照片,通 过比较可以看出:未经表面改性的 AR 膜的表面颗 粒小,尖峰多;表面改性后,随着提拉速度的加快, MTES 预聚体的覆盖量增多,膜层表面颗粒呈现出 增大的趋势。其中 AR-2M10 膜是在 2 倍浓度的 poly-MTES 涂膜液中以 10 cm/min 的提拉速度制 备的表面改性膜层。对图 5 中 AR 膜和 AR-M6.5 膜的局部放大图进行分析可知, AR 膜上涂制 MTES 预聚体后,表面的 SiO₂ 颗粒被 MTES 预聚 体填充覆盖,使得膜层表面的颗粒界限变得模糊。

3.3 膜层的表面粗糙度

膜层的表面粗糙度是大型激光器光束精密化的 一项重要指标,平滑的表面有利于光束质量的提高。 采用三维表面轮廓仪对膜层的表面粗糙度进行了测 量,结果如图6所示。从图6(a)、(b)可知,AR膜的



图 5 AR 膜表面改性前后的 AFM 图。(a) AR 膜;(b) AR-M5 膜;(c) AR-M6.5 膜;(d) AR-M10 膜;(e) AR-2M10 膜 Fig. 5 AFM images of coating surfaces before and after surface modification. (a) AR coating; (b) AR-M5 coating; (c) AR-M6.5 coating; (d) AR-M10 coating; (e) AR-2M10 coating





Fig. 6 Morphologies of coating surfaces. (a) AR-M6.5 coating before surface modification; (b) AR-M6.5 coating after surface modification; (c) AR+NH₃/HMDS coating before chemical atmosphere treatment; (d) AR+NH₃/HMDS coating after chemical atmosphere treatment

均方根粗糙度(R_q)为 1.763 nm, AR-M6.5 膜的 R_q 为 1.469 nm,这表明,致密的 MTES 预聚体薄层覆盖表面后,膜层的表面平整度得到提高,有利于大型

激光器的精密化。AR 膜进行 NH₃/HMDS 化学气 氛处理后,膜层的 R_q 由 1.146 nm 变为1.283 nm, 表面的 Si $-O-Si(CH_3)_3$ 基团使得表面粗糙度稍 有增大。

3.4 膜层的透过率稳定性

膜层的稳定性对激光器能否长期稳定运行至关 重要,提高膜层的环境稳定性、延长膜层使用寿命是 膜层改进的重要课题。为分析膜层的稳定性,将 AR 膜、AR+NH₃/HMDS 膜和 AR-M6.5 膜样片置 于相对湿度约为 95%(95%RH)的干燥器中,分别 在第 183 天和第 475 天取出样片测试透过率。

图 7 结果显示,在 95% RH 下存放 183 d 后, AR 膜、AR+NH3/HMDS 膜和 AR-M6.5 膜的透过 率峰值分别为 98.20%、99.18% 和 99.52%。AR 膜 层中 SiO₂颗粒表面的硅羟基吸收水分多,峰值透过 率降低了1.51%,该膜层受环境相对湿度的影响很 大; $AR + NH_3 / HMDS$ 膜的透过率峰值降低了 0.27%, 膜层的稳定性较 AR 膜明显提高; AR-M6.5 膜的透过率峰值降低了 0.15%,约为 AR 膜的1/10, AR+NH₃/HMDS 膜的 1/2, AR-M6.5 膜层的稳定 性比 AR+NH₃/HMDS 膜更好。在 95%RH 湿度 环境下放置 475 d 后, AR+NH₃/HMDS 膜的透过 率峰值为 98.16%,透过率降低明显(比实验前降低 了 1.29%)。经过大量水汽超长时间的渗透后,一部 分Si-O-Si(CH₃)₃可能重新置换成Si-OH基 团,这些Si-OH基团吸收水汽进入膜层内部,导致 透过率明显降低。AR-M6.5 膜在 95% RH 湿度环

before test

境中放置 475 d 后,透过率峰值达到 99.09%(比实 验前降低了 0.58%),维持了良好的减反射性能。这 说明 AR-M6.5 膜表面的 MTES 预聚体薄层形成了 保护层,隔绝了大部分 SiO₂颗粒层与空气的接触, 只有少量水汽进入膜层内部,膜层表面的封闭性较 好。表1比较了三种膜层在95%RH相对湿度的环 境中放置后的接触角。热处理后的 AR 膜层呈现疏 水性,在95%RH下放置8d变成亲水性,接触角下 降至 47.5°,湿度实验结束后的接触角仅为 17.3°。 AR+NH₃/HMDS 膜和 AR-M6.5 膜的接触角在短 期内均无明显下降,17个月后的接触角分别为56.6° 和 70.3°,说明 MTES 预聚体表面改性的膜层抵御 水汽的能力更强。与目前采用化学气氛处理方法制 备的三倍频元件 SiO,减反膜相比,经 MTES 预聚 体表面改性的膜层因 SiO₂颗粒层表面有一层致密 的薄层,表面的封闭性更好,具有更高的透过率稳定 性,可应用于次防溅射板减反膜。次防溅射板实际 使用时有两种情况:1)激光器运行后,靶材直接溅射 到膜层表面,未进入膜层内部,此时表面改性膜层与 化学气氛处理的膜层相似;2)换靶时,靶室由真空回 到常压,气化的靶材发生液化/固化,这个过程中膜 层表面是开放状态,如果利用传统的化学气氛处理 减反膜,污染物会渗透到膜层内部。而 AR-M 膜表 面有一层致密的薄层,靶材污染集中于膜层表面。





Fig. 7 Influence of relative humidity on peak transmittance

表 1	膜层	的水	接	触	角
• •					

Table 1	Water	contact	angle	of	modified	coatings
---------	-------	---------	-------	----	----------	----------

Film		AR	$AR + NH_3 / HMDS$	AM-M6.5
	0 d	120.3	123.9	123.6
Contact angle $/(^{\circ})$	8 d (95%RH)	47.5	120.4	121.3
	17 months (95%RH)	17.3	56.6	70.3

尤其是在第二发激光辐照时,膜层表面的污染物会 挥发,而存在于内部的污染物不一定挥发,不挥发的 污染物残留在内部堵塞孔洞,降低透过率,内部挥 发的污染物可能发生膨胀气化,对结构造成破坏。 逐次累积的激光辐照后,有表面保护层的 AR-M6.5 膜相对更稳定,可增加承受的发次,延长次防溅射板 的使用寿命。

3.5 激光损伤阈值

膜层的激光损伤阈值是影响整套高功率激光系 统性能的重要指标。以石英玻璃为基片,采用提拉 法制备膜层,在中国科学院上海光学精密机械研究 所高功率激光物理联合实验室的激光损伤测试平台 上,采用 1-on-1 的方式测试膜层的激光损伤阈值。 激光波长为 351 nm,脉冲宽度 5 ns,光斑直径按半 峰全宽计算为 0.15 nm。AR-M6.5 膜层的激光损 伤阈值为 24.5 J/cm²,同时测试了空白石英玻璃的 激光损伤阈值,结果为 23.49 J/cm²,可见,AR-M6.5 膜层可以满足高功率激光器对膜层激光损伤阈值的 要求。

4 结 论

采用溶胶-凝胶法在石英玻璃上制备了表面改 性的 SiO₂ 减反 膜。该 膜层的透过率峰值可达 99.67%,折射率为 1.231,水接触角达到 123.6°,膜 层表面平整,激光损伤阈值为 24.5 J/cm²。表面改 性 SiO₂减反膜在 95% RH 下放置 475 d 后仍保持 99.09%的高透过率,说明 MTES 预聚体覆盖在膜 层表面形成了保护层,有效阻挡了水汽的渗透,大大 提高了膜层的稳定性。该膜层的透过率稳定性优于 高功率激光器使用的经化学气氛后处理后的 SiO₂ 减反膜,有望应用于三倍频光学元件,对于高功率激 光器最后一块需频繁更换的次防溅射板来说,可以 提高其使用寿命,降低激光器的运行成本。

参考文献

- Thomas I M. High laser damage threshold porous silica antireflective coating [J]. Applied Optics, 1986, 25(9): 1481-1483.
- [2] Suratwala T, Carman L, Thomas I. NIF antireflective coating solutions: preparation, procedures and specifications[R]. United States: [s.n.], 2003: UCRL-ID-154626.

- [3] Shen B, Li H Y, Zhang X. Properties of sol-gel-modified SiO₂ antireflective films by spin coating[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(14): 141602.
 沈斌,李海元,张旭.旋涂法涂制溶胶凝胶改性SiO₂ 减反膜性能研究[J].激光与光电子学进展, 2019, 56(14): 141602.
- [4] Thomas I M, Burnham A K, Ertel J R, et al. Method for reducing the effect of environmental contamination of sol-gel optical coatings[J]. Proceedings of SPIE, 1999, 3492: 220-229.
- [5] Li H Y, Tang Y X. Study on stability of porous silica antireflective coatings prepared by sol-gel processing[J]. Chinese Journal of Lasers, 2005, 32(6): 839-843.
 李海元, 唐永兴. 溶胶-凝胶多孔二氧化硅减反膜稳 定性研究[J]. 中国激光, 2005, 32(6): 839-843.
- [6] Shen J, Liu Y, Li X G. Surface modification and contamination resistance of sol-gel SiO₂ derived antireflective coatings[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2010, 38(11): 2054-2058.
 沈军,刘源,李晓光.溶胶-凝胶 SiO₂ 减反膜的表面 修饰和抗污染特性[J]. 硅酸盐学报, 2010, 38(11): 2054-2058.
- [7] Yan L H, Zhao S N, Lü H B, *et al*. Preparation of durable hydrophobic and antireflective silica coating[J]. Laser Technology, 2010, 34(4): 463-465, 481.
 晏良宏,赵松楠,吕海兵,等.持效疏水 SiO₂增透膜的制备和研究[J].激光技术,2010,34(4): 463-465,481.
- [8] Suratwala T I, Hanna M L, Miller E L, et al. Surface chemistry and trimethylsilyl functionalization of Stöber silica sols [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2003, 316(2/3): 349-363.
- [9] Hui H H, Yang W, Zhang Q H, et al. Preparation of hydrophobic self-assembled SiO₂ coatings by solgel method[J]. Journal of Applied Optics, 2011, 32(4): 761-766.
 惠浩浩,杨伟,张清华,等.溶胶-凝胶法制备疏水性 自组装 SiO₂薄膜[J].应用光学, 2011, 32(4): 761-766.
- [10] Xu Y, Fan W H, Li Z H, et al. Antireflective silica thin films with super water repellence via a solgel process[J]. Applied Optics, 2003, 42(1): 108-112.
- [11] Thomas I M. Two-layer broadband antireflective coating prepared from methyl silicone and porous silica[J]. Proceedings of SPIE, 1997, 3136: 215-219.